

2026年5月12日

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン、シクロオレフィンポリマーの原料生産能力増強によりC₅事業の競争力強化 水島工場 GPI 設備に追加投資

日本ゼオン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:豊嶋 哲也 以下、ゼオン)は、水島工場(岡山県倉敷市、工場長:森 靖雅)において GPI¹⁾ プラントに新たな設備を追加し、能力増強を図る投資を決定しました。これにより、ゼオンの C₅ 事業の軸で成長ドライバーにも位置付けるシクロオレフィンポリマー(以下、COP)および COP 製光学フィルムなどの主原料となるジシクロペンタジエン(以下、DCPD)の生産能力が現行比で最大 2 割程度向上します。本投資により、汎用品向け主原料であるピペリレンなどの生産量を増やすことなく、DCPD の安定確保が可能となります。さらに、これまで未利用であった成分を有効活用することで、CO₂ 排出量の削減にも寄与します。工事は、2026年度下期に着工し、2028年9月完工を目指します。

ゼオン水島工場は、GPI 法を活用した C₅ 留分総合利用工場として 1969 年に操業を開始したゼオンの基幹工場です。GPI法により生み出されるイソプレン、DCPD、ピペリレン、2-ブチンといった有効成分を合成ゴムやCOP、石油樹脂、合成香料などの様々な製品へと展開しています。

DCPD は、COP のほか RIM 配合液などの高収益製品の原料として使用されており、特にCOPおよび COP 製光学フィルムは、中期経営計画STAGE30において、着実に拡大を見込む成長ドライバーに設定され、今後の需要拡大が見込まれています。^{*2} こうした拡大基調に対する原料調達について様々な検討を重ねてきた結果、これまで未利用であった成分を活用する技術の確立により、C₅ 留分を追加調達することなく、安定的な原料確保が可能となりました。

また、今回の方法は、C₅ 留分からの抽出に比べ、CO₂ 排出削減効果が見込まれ、カーボンニュートラルにも寄与します。

ゼオンは、STAGE30 において、「選択と集中」によるポートフォリオの組み換えを推進しており、今回の投資により C₅ 事業のさらなる拡大に加え、競争力強化を図ります。ゼオンは今後も市場ニーズを捉え社会の期待に応えるとともに、人々の快適な暮らしに貢献してまいります。

*1:ゼオン・プロセス・オブ・イソプレン法の略。ナフサに含まれる C₅ 留分から抽出蒸留によって高純度の有効成分を取り出すゼオン独自の技術。

*2:需要拡大に対応すべく、COP に加え、COP 製光学フィルムの能力増強工事にも着手。

[日本ゼオン、シクロオレフィンポリマーの新プラント建設工事の起工式を挙行 2028年度上期の竣工を目指す](#)

[日本ゼオン、氷見二上工場で位相差フィルム製造ライン増設工事の起工式を挙行](#)



水島工場 GPI プラント外観

以上

本件に関するお問い合わせ先: 日本ゼオン株式会社 経営企画統括部門 広報室

電話: 03-3216-2747 お問い合わせフォームは [こちら](#)